フォトニック結晶レーザと2次元マトリックストランジスタの集積 Photonic Crystal Lasers with Two-Dimensional Matrix of Transistors ^o福原 真,小林 大河, Menaka De Zoysa,石崎 賢司,吉田 昌宏,初田 蘭子,田中 良典,野田 進 京大院工

°S. Fukuhara, T. Kobayashi, M. De Zoysa, K. Ishizaki, M. Yoshida, R. Hatsuda, Y. Tanaka, S. Noda Kyoto Univ.

E-mail: shin.fukuhara@qoe.kuee.kyoto-u.ac.jp, snoda@kuee.kyoto-u.ac.jp

[序] フォトニック結晶レーザ(PCSEL)は,量子井 戸近傍に設けた 2 次元フォトニック結晶におけ るバンド端共振効果を活用した大面積・面発光半 導体レーザである.本レーザは大面積コヒーレン ト動作¹)に加え,ビームパターンの制御²,出射 方向の制御³など多機能性を有する新型半導体 レーザである.前回,面内相互引き込み現象⁴ を活用した面内発振状態のオンデマンド制御や, 出射方向の制御などが可能となるように,面内の発 振領域を任意に駆動可能な2次元マトリックス状の トランジスタ構造を PCSEL に導入可能なことを提 案した⁵.今回, PCSEL 上に,2次元マトリックス トランジスタを作製し,かつ,所望の領域を駆動す ることに成功した結果を報告する.

[実験]マトリックストランジスタを導入した PCSEL を模式的に図1に示す.本構造では,エミッタライ ンとベースラインの交点を選択的に励起出来,狙っ た領域に電流注入が可能である.集積デバイスは、 基板上に、PCSEL構造を形成したのち、反射膜とし て DBR (distributed Bragg reflector)を形成し、その上 に,厚さ 500nmの p-GaAs コレクタ層,厚さ 450nm の n-GaAs ベース層,厚さ 550nmの p-Al_{0.35}Ga_{0.65}As エミッタ層からなるヘテロ接合 pnp トランジスタ構 造が形成されている.その後,ベース層の露出,素

子分離を行い,エミッタ電極とベース電極を形成した.エミッタ のサイズは 30µm 角とし,エミッタ用とベース用のライン電極を SiO₂の絶縁膜を挟んで形成し,10×10のマトリックス構造とし, 最後にn型窓電極を形成した.図2の断面 SEM 像に示すように, PCSEL上にマトリックストランジスタが良好に集積出来ているこ とが分かる.異なる2つの単一領域を発振させたときの,試料の 窓電極側(n側)から観測した近視野像をそれぞれ図3に示す.図4 には図3(a)の領域の発振スペクトルを示す.発振波長は狙いの ~940nmで,このときのコレクタ電流は35mA であった.これらの 図より,狙った領域を選択的に発振させられることが分かる.複 数領域を同時駆動させたときの動作など,詳細は,当日報告する. なお,本研究は,JST CREST の支援を受けた.

[文献] [1] K. Hirose et al, *Nature Photonics*, **8**, 406 (2014). [2] E. Miyai et al, *Nature*, **441**, 946 (2006). [3] 沖野他, 2013 年春応物 28p-C1-14. [4] 小林他, 2017 年春応物 14p-P7-4. [5] 小林他, 2018 年春応物 20a-P3-13.



Fig. 1. Schematic diagram of the PCSEL with 2D matrix of transistor



Fig. 2. Cross sectional view of the PCSEL with 2D matrix of transistor



Fig. 3. Near-field pattern after lasing.

